【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第１区分
【発行日】平成18年1月5日(2006.1.5)

【公開番号】特開2004-253397(P2004-253397A)
【公開日】平成16年9月9日(2004.9.9)
【年通号数】公開・登録公報2004-035
【出願番号】特願2004-133634(P2004-133634)
【国際特許分類】
　Ｈ０１Ｊ　9/50　(2006.01)
【ＦＩ】
　Ｈ０１Ｊ　9/50　Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成17年11月15日(2005.11.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】発明の名称
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の名称】フラットディスプレイのガラス基板の処理方法
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ガラス基板の表面状態を検出し、その検出結果に応じて基板表面を処理する方法であって、
　前記ガラス基板表面に１次Ｘ線を照射し、発生した蛍光Ｘ線を検出することによりガラス基板表面に存在する元素を検出する検出工程と、
　検出工程の検出結果に応じて前記ガラス基板表面からガラス構成元素以外の元素を除去する除去工程とを有することを特徴とするフラットディスプレイのガラス基板の処理方法。
【請求項２】
　前記ガラス基板表面の元素を検出する検出工程において、
前記ガラス基板の大きさに応じて前記ガラス基板と蛍光Ｘ線検出器の相対位置が変化することを特徴とする請求項１に記載のフラットディスプレイのガラス基板の処理方法。
【請求項３】
　蛍光Ｘ線検出器が、蛍光Ｘ線を検出し得る領域よりも広い領域に１次Ｘ線を照射することを特徴とする請求項１に記載のフラットディスプレイのガラス基板の処理方法。
【請求項４】
　ガラス基板に１次Ｘ線を入射する際の入射角が、１次Ｘ線の臨界角以下の角度であることを特徴とする請求項１に記載のフラットディスプレイのガラス基板の処理方法。
【請求項５】
　ガラス基板表面に対する除去工程が、ガラス基板表面を研磨することにより行われることを特徴とする請求項１に記載のフラットディスプレイのガラス基板の処理方法。
【請求項６】
　ガラス基板表面に対する検出工程および除去工程が、繰り返し行われることを特徴とす

る請求項１乃至５のいずれか１項に記載のフラットディスプレイのガラス基板の処理方法。

【請求項７】

ガラス基板上に複数の電子放出素子が配置されたリアプレートと、ガラス基板上に画像表示部が設けられたフェースプレートと、これらのプレートを対向配置するように接合する支持枠と、を含むフラットディスプレイのガラス基板の処理方法であって、

前記リアプレートおよび前記フェースプレートを分離して取り出した後、前記リアプレートまたは前記フェースプレートの基板表面に対して、請求項１乃至６のいずれか１項に記載の処理方法を適用することを特徴とするフラットディスプレイのガラス基板の処理方法。

【請求項８】

前記リアプレートにおいて、前記ガラス基板上にＡｇを主成分とする配線が形成されていることを特徴とする請求項７に記載のフラットディスプレイのガラス基板の処理方法。

【請求項９】

前記リアプレートを構成するガラス基板表面に、ガラス構成元素以外の元素を含む薄膜が形成されていることを特徴とする請求項７に記載のフラットディスプレイのガラス基板の処理方法。

【請求項１０】

前記リアプレート、前記フェースプレートおよび前記枠を接合するためのフリットガラスを溶解することにより、これらの部材を分離するようにしたことを特徴とする請求項７に記載のフラットディスプレイのガラス基板の処理方法。